

# ガラス基板への無電解銅めっきプロセス

Electroless copper plating process with high adhesion on glass substrate

# PLOPX

※パナソニック環境エンジニアリング株式会社と共同開発  
Jointly developed with Panasonic Environmental Systems & Engineering Co., Ltd.

- 液相析出法 (Liquid Phase Deposition; LPD法) により  
スズ酸化物層を形成したガラス基板への無電解銅めっきプロセス  
Electroless copper plating process from tin oxide layer by Liquid Phase Deposition (LPD method)
- 低粗度ガラス基板に対して高いめっき密着性が得られる  
High peel strength on low profile glass substrates
- TGVへのスルーホール析出性に優れる  
Excellent in the deposition performance into TGV (Through Glass Via)
- 絶縁信頼性、耐熱信頼性に優れる  
Excellent in insulation reliability and heat-resistant reliability

## 処理工程 Treatment Process

スズ酸化物製膜 (LPD層)  
Forming tin oxide, LPD layer

**PLOPXシード** (41°C, 2.5時間)  
PLOPX SEED 2.5h

Pd触媒付与  
Pd catalyzing

**PLOPXアクチベーター** (室温, 3分)  
PLOPX ACTIVATOR Room temp., 3min

熱処理① (300°C, 1時間)  
Heat treatment ① 1h

還元 Accelerating

**PLOPXリデューサー** (室温, 2分)  
PLOPX REDUCER Room temp., 2min

無電解銅めっき  
Electroless copper plating

**PLOPX銅** (32°C, 30分)  
PLOPX copper 30min

熱処理② (150°C, 1時間)  
Heat treatment ② 1h

硫酸銅めっき  
Acid copper plating

熱処理③ Heat treatment ③  
(窒素雰囲気, 370°C, 50分)  
Nitrogen atmosphere, 370°C, 50min

## 平滑で電気特性に優れたスズ酸化物層を製膜 Form flat and smooth tin oxide layer

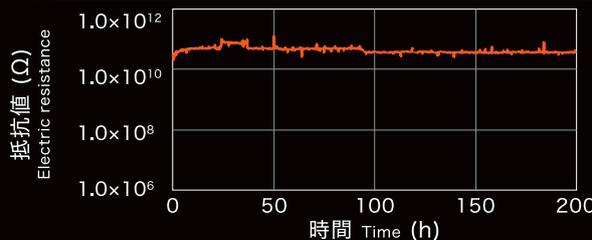


※LPD: Liquid Phase Deposition

	ガラス Glass	ガラス/LPD層 Glass/LPD layer
比誘電率 Dielectric constant	5.10	5.11
誘電正接 Loss tangent	0.0057	0.0057

測定方法 : TE共振法  
Measurement : TE Resonance Method  
測定周波数 : 28GHz  
Frequency  
測定回数 : 3回  
Number of times : 3times

## 絶縁信頼性に優れる Excellent in insulation reliability

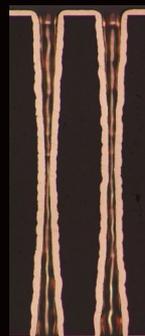


マイグレーション試験 Migration test (L/S=10/10µm)

試験条件: 110°C, 85%RH, 3.5 V, 200時間  
Test condition 200h

## TGVへのスルーホール めっき析出性に優れる

Excellent in through-hole deposition performance into TGV



板厚: 500µm  
Board thickness  
孔径: 50µm  
Hole diameter



板厚: 200µm  
Board thickness  
孔径: 50µm  
Hole diameter

## ガラス以外の難素材でも良好な めっき密着性が得られる

Good plating adhesion can be obtained on difficult materials other than glass.

	ピール強度 (N/cm) Peel strength
ガラス Glass	5.2
アルミナ Alumina	4.9
シリコンウエハ Silicon wafer	6.4